ナノ電子プローブによる磁気カイラル二色性(EMCD)測定

Measurements of Magnetic Chiral Dichroism Using Nano-Electron Probe

武藤俊介^{a*}, Rusz Ján^b

Shunsuke Muto and Ján Rusz

^a名古屋大学未来材料・システム研究所高度計測技術実践センター ^bウプサラ大学物理学・天文学部

要旨 磁性元素に局在する磁気角運動量(軌道/スピン角運動量)をナノ領域で測定するために、試料を通過する高速電子のエネルギー 損失分光(EELS)によって磁気カイラル二色性(MCD)信号を検出する手法をエネルギー損失磁気カイラル二色性(EMCD)測 定と呼ぶ.これは左右旋回円偏光X線を用いるX線吸収分光(XAFS)スペクトルの差を取るX線磁気円二色性(XMCD)のEELS 版と位置づけられる.2003年にウィーン工科大学のSchattschneiderらによって原理提唱されてから10余年を経た今,理論・実験 両面において多様な試行錯誤の後に、今や原子面分解能での磁気信号測定までが可能となり、現実の材料での定量測定応用まであ と一歩のところまで進展しつつある.本稿では、本主題の原理的基礎から始め、その後主として我々のグループが携わった成果を 中心に、この分野の現在までの発展の経緯と将来展望を解説する.

キーワード:強磁性体,磁気角運動量,磁気カイラル二色性,電子エネルギー損失分光,情報統計処理

1. はじめに

電子顕微鏡が単なる拡大鏡でなく,ナノ領域分光及び可視 化による物性分析ツールとして認識されるようになって既に 久しい.特に収差補正技術がごく当たり前になりつつある現 在,原子コラム毎の元素分析・状態計測がこの分野の中心課 題である一方,ソフトマテリアルや実用機能材料分析など既 存技術の延長上で解決できる未開拓の問題はまだ残っている.

材料科学における走査/透過電子顕微鏡(S/TEM)によ る構造解析及び化学分析の基礎は、主として電荷を担った高 エネルギー電子と固体ポテンシャルとの強いクーロン相互作 用に基づいており、このことが S/TEM 分析の利点と欠点の 双方を決定づけている.固体に入射した単色電子が様々な弾 性および非弾性散乱過程を経て固体の外へ出たときには、そ の強度・位相・速度の変化として、固体中の空間・化学構造 情報のほとんどを担っている.特に非弾性散乱による速度(運 動エネルギー)変化を測定する電子エネルギー損失分光法 (EELS)は、固体の化学状態を高い空間分解能で測定する点 においてこの 30 年間に急速に発展してきた.

本稿で解説する, TEM-EELSを用いて磁性元素に局在する 磁気角運動量を定量的に測定する手法をエネルギー損失磁気 カイラル二色性(EMCD)と呼ぶ.この手法は,非弾性散乱 電子間の位相干渉を利用する点で,特別な電子銃,検出器を 必要とせず,放射光/中性子回折が主な測定手段であった磁 気構造情報をサブナノ分解能で,更には原子サイト毎に取得 しうる可能性を秘めている.まとまった紙数をいただいたこ の機会に,磁気円二色性の起源を丁寧に解きほぐし,最近の 理論的取り扱いまで一貫した記述を試みたい.さらに他の場 所に書いた内容と一部重複するが^{1,2)},EMCDのこれまで進 展と今後の展望についても紙数の許す限り触れたいと思う.

2. 電子励起遷移のおさらい

EELS 分光を考察するに当たり、まず同じ固体内電子遷移 を取り扱う X線吸収分光法(XAFS)と比較しよう.フェル ミの黄金律に基づく次式で表される双極子近似の下での XAFS 吸収断面積³⁾:

$$\sigma_{\text{XAFS}} = 2\pi \hbar \alpha \omega \sum_{i,f} \left| \left\langle \psi_f \left| \mathbf{\epsilon} \cdot \mathbf{r} \right| \psi_i \right\rangle \right|^2 \delta(E_f - E_i - E) \tag{1}$$

に対し, EELS では小角散乱近似(**q** << 1 または双極子近似: **q·r** << 1)の範囲内で,二次微分散乱断面積(DDSCS)^{4,5)}:

$$\frac{\partial^2 \sigma}{\partial E \partial \Omega} = \frac{4(1-\beta^2)}{a_0^2 q^4} \frac{k_f}{k_i} \sum_{i,f} \left| \left\langle \psi_f \left| \mathbf{q} \cdot \mathbf{r} \right| \psi_i \right\rangle \right|^2 \delta(E_f - E_i - E)$$
$$= \frac{4(1-\beta^2)}{a_0^2 q^4} \frac{k_f}{k_i} S(\mathbf{q}, E)$$
(2)

によって表される.式(1),(2)を比較すると,電子遷移確 率を表す行列要素は同じ形をしていることがわかる.ここで (1)式のh, a, ω , ε はそれぞれプランク定数, 微細構造定数,

^a〒464-8603 名古屋市千種区不老町

TEL: 052-789-5200; FAX: 052-789-5137

^{*} E-mail: smuto@imass.nagoya-u.ac.jp

²⁰¹⁷年3月31日受付, 2017年5月25日受理

入射フォトンの角振動数及び偏光ベクトルを表し,(2)式の $a_0, \beta, \mathbf{q}, \mathbf{k}_i, \mathbf{k}_i$ はそれぞれボーア半径,v/c(ただしvは入射電 子の速度,cは光速),運動量移送ベクトル($\mathbf{q} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_i$),入 射及び散乱電子の波数ベクトルの大きさである。また(1), (2)式共通の ψ_i, ψ_j はそれぞれ固体内電子遷移の始状態i及び終状態fの波動関数, \mathbf{r} は電子位置座標, E_i, E_j はそれぞ れ始状態及び終状態電子準位,そしてEは遷移エネルギー (XAFS)または損失エネルギー(EELS)である。(2)式の 右辺の $S(\mathbf{q}, E)$ は動的構造因子(DFF)と呼ばれる。両式に おいて XAFS 分光における入射フォトンの偏光ベクトル ε と EELS における運動量移送ベクトル \mathbf{q} が等価な関係にあるこ とから,適当な実験配置を選ぶことによって XAFS と EELS は原理的にほぼ同様な情報を与えるとみて良い。

3. X線吸収分光における磁気円二色性(XMCD)

原理的な理解のために円偏光 X 線による MCD の起源を導 いてみよう. 図1(a) に典型的な磁性元素(Mn, Fe, Co) で ある 3d 遷移金属の 2p 始状態から 3d 非占有状態へのバンド 間遷移の模式図を示す.X線吸収分光法(XAFS)では軌道 角運動量量子数1が±1変化する双極子選択則によって、L23 ホワイトラインスペクトルを生じる. もし入射するX線が 磁化方向に対して円偏光しているときには、以下に示すよう に新たに磁気量子数について選択則が課される。そのために 図1(a)のようにdバンドのアップスピンとダウンスピン の数が異なるとき(正味の磁化を生じるとき), 軌道-スピ ン結合によって全角運動量 j = 1/2, 3/2 の二つに分裂した 2p12 及び 2p32 準位から d バンドの非占有状態への遷移確率 (それぞれ L。及び L。吸収スペクトル強度に対応する)に、 図1 (b) に示すような入射フォトンのヘリシティー(偏光 方向)の違いを反映する互い違いの変調を生じる.この2つ のスペクトル差が後の磁気モーメント定量解析に使われる MCD 信号である.

今正味の磁化の方向(またはスピン量子化軸の方向)をz軸に取り、この軸に対して時計方向(+)及び反時計方向(-)の円偏光ベクトル ε_{\pm} は、大きさが等しく互いに直交する2



図1 (a) 3d バンドに非占有状態のある遷移金属に円偏光フォ トンが入射した際の $2p \rightarrow 3d$ 電子遷移模式図. (b) 円偏光の ± ヘリシティーに対応する BCC 鉄の $L_{2,3}$ 吸収スペクトル μ^+ , μ^- 及びその差スペクトル $d\sigma$.

つのベクトル X, Yを使って $\varepsilon_{\pm} = X \pm iY$ (複合同順) と表し ても一般性を失わない. 虚数単位 i は 2 つの偏光ベクトルの 位相が常に $\pi/2$ 異なること (複素数表示で円偏光を保証する) を表す. さてある 3d 遷移金属原子一個について一電子近似 の枠内で $L_{2,3}$ 吸収ピークの円偏光フォトンによる電子遷移確 率を求めてみよう. 円偏光遷移オペレータ ε_{\pm} は球面調和関 数 Y_{-}^{m} を使って、

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\pm} = 2r \sqrt{\frac{2\pi}{3}} Y_1^{\pm 1} \tag{3}$$

と表しておくと後の計算が楽になる.電子の原子軌道関数を 使って電子遷移行列要素を書き下したとき,その角度部分

$$\left|\left\langle Y_{l'}^{m'} \middle| Y_1^h \middle| Y_l^m \right\rangle\right|^2 \tag{4}$$

を見ると,球面調和関数の性質から(4)式がゼロにならない条件,すなわち軌道角運動量量子数1と磁気量子数mに対して次の選択則:

$$l' = l \pm 1, \quad m' = m + h$$
 (5)

が導かれる⁵⁾. hはヘリシティーで、 ϵ_{\pm} に対して ± 1 の値を とる. これによって 2p (l = 1) から 3d (l = 2) への遷移に おいて以下の場合:

以外の遷移確率はすべてゼロとなる^{6,7)}.ただしここでは $L_{2,3}$ スペクトルのピーク強度比を議論するので、簡単のために原 子軌道関数の動径部分を考慮しないことにする.

次に 2p 始状態の固有状態 $\langle j, m_j |$ は上で述べたように全角 運動量量子数 $j (= l + m_s) = 3/2 \ge j = 1/2$ の 2 つに分裂し、そ れぞれスピン波動関数 $\langle m_s |$ と球面調和関数の直積 $\langle m_s | \langle Y_l^{m_l} |$ で表される以下のような 6 つの固有状態を作っている:

$$\left\langle j = \frac{3}{2}, m_j = \frac{3}{2} \right| = \left\langle m_s = \frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^1 \right|, \tag{7}$$

$$\left\langle j = \frac{3}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right| = \frac{\sqrt{3}}{3} \left\langle \sqrt{2} \left\langle m_s = \frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^0 \right| + \left\langle m_s = -\frac{1}{2} \left| \left\langle Y_1^1 \right| \right\rangle \right\rangle,$$
(8)

$$\left\langle j = \frac{3}{2}, m_j = -\frac{1}{2} \right| = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\left\langle m_s = \frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^{-1} \right| + \sqrt{2} \left\langle m_s = -\frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^{0} \right| \right),$$
(9)

$$\left\langle j = \frac{3}{2}, m_j = -\frac{3}{2} \right| = \left\langle m_s = -\frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^{-1} \right|,$$
 (10)

$$\left\langle j = \frac{1}{2}, m_j = \frac{1}{2} \right| = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\left\langle m_s = \frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^0 \right| - \sqrt{2} \left\langle m_s = -\frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^1 \right| \right),$$
(11)

$$\left\langle j = \frac{1}{2}, m_j = -\frac{1}{2} \right| = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\sqrt{2} \left\langle m_s = \frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^{-1} \right| - \left\langle m_s = -\frac{1}{2} \right| \left\langle Y_1^{0} \right| \right).$$
(12)

(8), (9), (11), (12) 式の右辺の数係数は(学生時代ディ ラックやランダウの量子力学教科書で苦しめられた方も多い かと思う) Clebsch-Gordan 係数である⁷⁾. これだけの準備を して, (6)-(12) 式とスピン波動関数の直交性 $\langle m_s | m'_s \rangle = \delta_{m_s,m_{s'}}$ を使って、 ε_{\pm} フォトン入射のときの2p 始状態から3d 終状 態の各スピン状態 $| Y_{2}^{m_{t'}} \rangle | m'_s \rangle$ への遷移行列要素が計算でき、 図 2 (a) のようなダイヤグラムにまとめられる. 3d 軌道 $| Y_{2,m_{t'}} \rangle | m'_s \rangle$ の空準位数 $N_{m_{t'},m_{s'}}$ を考慮すると、最終的にスペク トル強度を表す2p から3d 空準位への相対遷移確率は

$$\sum_{m,m'_{i},m'_{z}} N_{m_{i'},m_{z'}} \left| \left\langle j,m | \boldsymbol{\epsilon}_{\pm} | Y_{2}^{m_{i'}} \right\rangle \right| m'_{z} \right\rangle^{2} \tag{13}$$

に比例する. このダイヤグラムを使って 3d 遷移金属の $L_{2,3}$ ピークの相対強度比を求めてみよう. まず 3d 軌道の $m'_s = 1/2$ (アップスピン ↑) と $m'_s = -1/2$ (ダウンスピン ↓) が すべて空いている場合もしくは同じ数だけ占められている 場合 ($N_{m_r,1/2} = N_{m_r,-1/2}$) は L_3/L_2 ピーク強度比は偏光にか かわらず

$$\frac{\sum_{m,m'_{i},m'_{z}} N_{m'_{i},m'_{z}} \left| \left\langle j = \frac{3}{2}, m \left| \mathbf{\epsilon}_{\pm} \right| Y_{2}^{m'_{i}} \right\rangle \right| m'_{s} \right\rangle \right|^{2}}{\sum_{m,m'_{i},m'} N_{m'_{i},m'_{z}} \left| \left\langle j = \frac{1}{2}, m \left| \mathbf{\epsilon}_{\pm} \right| Y_{2}^{m'_{i}} \right\rangle \left| m'_{s} \right\rangle \right|^{2}} = \frac{\frac{16}{15} + \frac{8}{15}}{\frac{2}{15} + \frac{10}{15}} = \frac{2}{1} \quad (14)$$

となる. しかし 3d 軌道の↑スピン数と↓スピン数が異なる 場合, すなわち正味の磁気モーメントを生じるとき, 例えば 3d 軌道の↑スピン状態がすべて占有され, ↓スピン状態が すべて空いている場合 $(N_{m_{l'},1/2}=1, N_{m_{l'},-1/2}=0)$ に $h = \pm 1$ 偏光入射の L_3/L_2 ピーク強度比をそれぞれ計算してみると,

$$h = +1: \frac{\sum_{m,m'_{i},m'_{s}} N_{m'_{i},m'_{s}} \left| \left\langle j = \frac{3}{2}, m | \boldsymbol{\epsilon}_{+} | Y_{2}^{m'_{i}} \right\rangle | m'_{s} \right\rangle \right|^{2}}{\sum_{m,m'_{i},m'_{s}} N_{m'_{i},m'_{s}} \left| \left\langle j = \frac{1}{2}, m | \boldsymbol{\epsilon}_{+} | Y_{2}^{m'_{i}} \right\rangle | m'_{s} \right\rangle \right|^{2}} = \frac{\frac{8}{15}}{\frac{10}{15}} = \frac{4}{5}$$
(15)

$$h = -1: \frac{\sum_{m,m'_{i},m'_{s}} N_{m'_{i},m'_{s}} \left| \left\langle j = \frac{3}{2}, m \left| \epsilon_{-} \right| Y_{2}^{m'_{i}} \right\rangle \right| m'_{s} \right\rangle \right|^{2}}{\sum_{m,m'_{i},m'_{s}} N_{m'_{i},m'_{s}} \left| \left\langle j = \frac{1}{2}, m \left| \epsilon_{-} \right| Y_{2}^{m'_{i}} \right\rangle \right| m'_{s} \right\rangle \right|^{2}} = \frac{\frac{16}{15}}{\frac{2}{15}} = \frac{8}{1}$$
(16)

となり, 図2 (b) に示すような $L_{2,3}$ スペクトルの強度に特 徴的な二色性が現れる. 以上から MCD の起源は \uparrow スピン状 態と \downarrow スピン状態の占有率の差であることがわかる.



図 2 (a) h = +1 (h = -1) のときの $2p \rightarrow 3d$ 電子遷移における $\left|\left\langle j, m | \epsilon_{\pm} | Y_2^{m_r} \right\rangle | m_s' \right\rangle^2$ の値のダイヤグラム. (b) (a) の値に基づいて $h = \pm 1$ に対する $L_{2,3}$ スペクトル $\mu^{\pm}(E)$ とその差スペクトル (MCD 信号) の模式図.



図3 (a) Classical EMCD 実験配置. 結晶試料が位相シフトを 伴うビーム分割器としての役割を果たす. (b) 回折面における EMCD カイラル±配置 (EELS 検出器位置 A, B).

4. EMCD 測定の基礎

4.1 Classical EMCD 測定のための実験配置とその測定原理 前節までの議論を踏まえると、MCD 測定を EELS によっ て可能にするためには、フォトンの円偏光ベクトルの代わり に2つの互いに直交する運動量移送ベクトル q, q'を使って q ± iq'と表される実験配置をとればよい⁸⁾(図3).二波励 起運動学的回折条件の下で、ブラッグ反射した波は透過波に 対して位相が π/2 異なるので、図3に示した2つの EELS 検 出器の位置がまさしくそのような一組の条件を満たしてい る.この場合の透過波、反射波及び一組の検出器位置は幾何 学的に Thales 円と呼ばれる1つの円上に載る.2つの逆格 子点を始状態とし、それぞれから検出器へと張るベクトル q, q'の方向に非弾性散乱された電子の波動関数を終状態とす ると、(2)式は

$$\frac{\partial^2 \sigma}{\partial E \partial \Omega} = \frac{4(1-\beta^2)}{a_0^2} \frac{k_f}{k_i} \left(\frac{S(\mathbf{q},\mathbf{q}',E)}{q^4} + \frac{S(\mathbf{q},\mathbf{q}',E)}{q^{\prime 4}} \mp 2 \frac{\Im \left[S(\mathbf{q},\mathbf{q}',E) \right]}{q^2 {q^{\prime 2}}} \right)$$
(17)

のように,2つの直接散乱項と1つの干渉項で表される^{9,10}. ただし3[*] は関数 * の虚部を表す.ここでは(2) 式の DFF は混合動的構造因子(MDFF):

$$S(\mathbf{q},\mathbf{q}',E) = \sum_{i,f} \langle \psi_f | \mathbf{q} \cdot \mathbf{r} | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \mathbf{q}' \cdot \mathbf{r} | \psi_f \rangle \delta \langle E_f - E_i - E \rangle$$
(18)

に置き換えられている. 図**3**の検出器 A, B 位置でそれぞれ 取得したスペクトルを μ^+, μ^- とすると EMCD 信号 $\Delta \sigma$ は,

$$\Delta \sigma = \mu^+(E) - \mu^-(E) \tag{19}$$

で与えられる(図1(b)及び2(b)参照). すなわち(17) 式の直接項は相殺され,結局磁気信号は(17)式の第三項(干 渉項)の虚部に比例することになる. さらに TEM の場合対 物レンズの強い外部磁場が光軸に平行にかかっているので, 多くの場合試料の正味の磁化方向Mは,試料表面の法線に 平行と見て良く,双極子近似の範囲で,

$$\Delta \sigma = \mu^{+}(\mathbf{E}) - \mu^{-}(\mathbf{E})$$
$$= \frac{16(1-\beta^{2})}{a_{0}^{2}q'^{2}} \frac{k_{f}}{k_{i}} \Im [S(\mathbf{q},\mathbf{q}',E)] \propto (\mathbf{q} \times \mathbf{q}') \cdot \mathbf{M}$$
(20)

のように簡略化される^{9,10)}. (20) 式を最大化するのは2つの 運動量位相ベクトル q, q'の大きさが同じで互いに直交する 図3 (b) の配置であることが分かる. このとき XMCD の円 偏光入射フォトンの±ヘリシティーに対して, EMCD では 磁化軸に対する q, q'の関係が互いに左手系と右手系の関係 にあるために対応する磁気信号について正負のカイラリ ティー(あるいはカイラル±)と呼ぶことにする.

(17) 式及び(20) 式は EMCD におけるいわば運動学的回 折条件下の二波近似式と言って良かろう. さらに系統反射列 励起条件にまで拡張して展開すると, d バンドの軌道角運動 量 *m*_L とスピン角運動量 *m*_s に対して以下のような総和則が 導かれる^{11,12}:

$$\int_{L_3} \Delta \sigma dE - 2 \int_{L_2} \Delta \sigma dE = K \left(\frac{1}{3} m_s + \frac{7}{3} \langle T_Z \rangle \right) (= 3p - 2q) \qquad (21)$$

$$\int_{L_3+L_3} \Delta \sigma dE = K \frac{1}{2} m_L (=q), \qquad (22)$$

ここで $\int_{L_{a}} \Delta \sigma dE$ (*n* = 2, 3) は得られた EMCD 信号スペクト ルの L₃ または L₂ ピーク領域での積分を表し, *p*, *q* はそれぞ れ EMCD 信号の L₃ ピーク領域だけ,及びスペクトル全域に わたる積分の値である¹³⁾.また*K* は試料厚みに依存する動力 学散乱効果に関連するすべての情報を含む係数, $\langle T_{z} \rangle$ は MDFF を展開する際に現れるdバンドの磁気双極子演算子の 期待値である¹¹⁾. EMCD 実験では係数*K* の値を決めること は簡単ではないので,通例 (21), (22) 式の比をとって¹²⁾,

$$\frac{\int_{L_3} \Delta \sigma dE - 2 \int_{L_2} \Delta \sigma dE}{\int_{L_3+L_2} \Delta \sigma dE} = \frac{3p - 2q}{q} = \frac{4m_s + 14\langle T_z \rangle}{3m_L}, \quad (23)$$

立方対称構造の試料では(T₂)を無視することができるので,



図4 EMCD 信号(実践)に総和則を適用して m_1/m_s を算出 するための模式図. 点線は EMCD 信号の累積積分(符号反転 している)を表す.

(23) 式が実験スペクトルから軌道/スピン角運動量比 m_1/m_s を定量的に与える式となる. 図4に示すように,実験スペクトルの累積積分の最大値(=p)を1に規格化したときの最終値(=q)を次式

$$\frac{m_L}{m_S + 7\langle T_z \rangle} = \frac{2q}{9 - 6q} \tag{24}$$

に代入することで即座に $m_{\rm L}/m_{\rm S}$ を計算できる¹³⁾.

4.2 EMCD 信号の動力学散乱効果・チャネリング効果

前項までの議論で、定性的に EMCD 測定原理が示された が、現実には S/TEM 関連分析に宿命とも言える動力学散乱 効果(多重散乱・多重ロス)を考慮に入れた考察が必須であ る.非弾性散乱を含めた動力学散乱理論は、吉岡による最初 の定式化の後¹⁴⁾、Schattschneider ら¹⁵⁾、Allen ら¹⁶⁾ によって 現代的な形に定式化された.以下、Schattschneider らによる 取り扱い¹⁵⁾ に従おう.

固体中での弾性/非弾性散乱過程において高速電子の波動 関数は、入射波・散乱波は双方ともブロッホ波の重ね合わせ でそれぞれ表され:

$$\psi_{in}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{g}} \sum_{j} \epsilon^{(j)} C_{\mathbf{g}}^{(j)} e^{i(\mathbf{k}^{(j)} + \mathbf{g}) \cdot \mathbf{r}}, \qquad (25)$$

$$\psi_{out}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{h}} \sum_{l} \epsilon^{(l)} D_{\mathbf{h}}^{(l)} e^{i(\mathbf{k}^{(l)} + \mathbf{h}) \cdot \mathbf{r}}.$$
(26)

ただし $C_{g}^{(j)}$ および $D_{h}^{(l)}$ はそれぞれ入射波および散乱波のブロッホ波の成分重みで、次の固有値方程式(ブロッホ波で展開した結晶中のシュレディンガー方程式):

$$\sum_{\mathbf{g}} \left[K^2 - \left(\mathbf{k}^{(j)} + \mathbf{g} \right)^2 + \sum_{\mathbf{h} \neq 0} U_{\mathbf{h}} C_{\mathbf{g} - \mathbf{h}}^{(j)} \right] e^{i(\mathbf{k}^{(j)} + \mathbf{g}) \cdot \mathbf{r}} = 0$$
(27)

の解 (U_h は結晶ポテンシャルの逆格子に対するフーリエ展 開係数)として与えられる. $\epsilon^{(j)}$ は境界条件で決まるブロッ ホ波分枝の励起パラメータである.このとき電子の全波動関 数は、非弾性散乱に伴う始状態及び終状態の固体内電子の波 動関数にそれぞれ (25)、(26)式の形を持つ入射電子の波動 関数を直積した形になる.それらを再び (2)式に代入して 展開すると DDSCS は次式のようになる:



図5 動力学的非弾性散乱理論によって予測されるBCC鉄のG = 200二波励起条件での磁気信号強度の回折面上分布の試料厚さ 依存性. 左上図内の点線円はThales円を示す. 磁気信号の強度・ 符号はL₃ピーク位置での非磁気信号に対する相対強度で示す.

$$\frac{\partial^2 \sigma}{\partial E \partial \Omega} = \sum_{\mathbf{g}, \mathbf{h}, \mathbf{g}', \mathbf{h}'} \frac{1}{N_{\mathbf{u}}} \sum_{\mathbf{u}} \frac{S(\mathbf{q}, \mathbf{q}', E)}{q^2 {q'}^2} e^{i(\mathbf{q} - \mathbf{q}') \cdot \mathbf{u}} \sum_{j, l, j', l'} Y_{\mathbf{g} \mathbf{h} \mathbf{g}' \mathbf{h}'}^{j l j' l'} T_{j l j' l'} (t)$$
(28)

$$Y_{\mathbf{ghg'h}'}^{jjj'l'} = C_0^{(j)*} C_{\mathbf{g}}^{(j)} D_0^{(l)*} D_{\mathbf{h}}^{(l)} C_0^{(j')*} C_{\mathbf{g}}^{(j')} D_0^{(l')*} D_{\mathbf{h}}^{(l')}$$
(29)

$$T_{jlj'l'}(t) = e^{i \left[\left[y^{(l)} - y^{(l')} \right] + \left(y^{(l)} - y^{(l')} \right) \right] \left[\frac{t}{2} \right]} \frac{\sin \varDelta \left[\frac{t}{2} \right]}{\varDelta \left[\frac{t}{2} \right]}$$
(30)

$$\Delta = \left(\gamma^{(j)} - \gamma^{(j')}\right) - \left(\gamma^{(l)} - \gamma^{(l')}\right) \tag{31}$$

$$\mathbf{k}^{(j)} = \mathbf{\chi} + \gamma^{(j)} \mathbf{n} \tag{32}$$

ただし、 χ は入射電子の真空中の波数ベクトル、nは試料表面の単位法線ベクトルである. (25)–(32) 式によって実際の 試料方位・厚さに対する磁気信号の強度が計算される. 一例 を図5に示す^{13,17)}. 弾性/非弾性散乱電子がチャネリング効 果を伴って試料中を伝播するこの計算は計算機負荷が非常に 大きく、様々な効率化を図っている^{17,18)}.

図5を見ると試料厚さに従い、回折面上のカイラル±の 磁気信号強度分布が多重散乱効果によって複雑に変化してい ることがわかる.最も薄い厚さ10nmの場合でも、磁気信 号強度が最も強い位置は運動学的理論((20)式)で予測さ れるThales 円上ではないことに注目して欲しい.このこと は実験的に EMCD 測定が難しい1つの理由となっている. 一般的に最適な検出器位置はThales 円上よりブラッグ回折 斑点側にずれた位置にある.

5. EMCD 測定のこれまでの発展経緯

2003 年に TEM-EELS による磁気二色性測定の可能性を提 案したのがウィーン工科大学の Shattschneider らである¹⁹⁾. その後2006年に同じグループによって初めて実験的に原理検 証された⁸⁾. これを契機に理論・実験の両面における進展に よってナノメートル分解能を達成する⁹⁾ と同時期に m_1/m_s の 最初の定量測定が行われた¹²⁾. XMCD に対する EMCD の利 点は空間分解能であり、STEM-EELS を利用した原子レベル 定量測定が究極の目標となる.しかしながら Classical EMCD 配置では内殻電子励起スペクトルの強度は通常の逆格子点を 検出器位置に含む測定に比べ一桁以上小さいこと,及びカイ ラル±位置に検出器を配する測定を試料の同じ場所で二回 繰り返さなくてはならないために装置の安定性や試料の照射 損傷による変質など様々な現実的問題に直面することになる.

また低い S/N 比のデータから磁気信号を抽出するために, エネルギーフィルター回折(EF-DIF)スペクトラムイメー ジ(SI)の各象限から対称性を考慮したデータ折りたたみを 行って統計を改善することが提案されたが²⁰⁾, EF-DIF-SIで はスペクトルのエネルギー分解能が検出器のエネルギース リット幅で制限され,各スリット位置でのデータ取得時間も 長いために実用的ではない.いずれにしても実空間あるいは 逆空間でのデータ点数を稼ぎ,さらに洗練された統計・情報 処理法によって磁気信号を抽出することが EMCD 実用化に とって不可欠である¹³⁾.この話題に関して筆者らのグループ による最新の動きについては別のところで紹介した^{1,2,21,22)}.

そのほかに筆者らによる超高圧電子顕微項を利用した加速 電圧効果²³⁾及びナノ多結晶の測定²⁴⁾,また中国のグループに よる ALCHEMI 法を応用したサイト選択的 EMCD 測定^{25,26)}, 欧州のいくつかのグループによる磁性金属微粒子^{27~29)}への 応用が特筆されるが、これらも紙面の都合上ここでは詳しく は触れない.残念ながらこれらの多くの実験では得られた EMCD 信号強度は非常に小さく、その S/N 比から考えると、 定量評価に耐えうるものはほとんど無く、厳しい目で見ると 本当の磁気信号かノイズの数値処理による偶然の EMCD 様ス ペクトルか判別の難しい場合すら散見される.そのため、デー タの統計・情報学的な検討の重要性は増す一方である^{22,24)}.

6. ナノビームによる位置敏感 EMCD 測定

6.1 金属/酸化物磁気トンネル接合界面³⁰⁾

EMCD の最大の利点は、サブナノメートル空間分解能を持 つことであろう.そこで Classical EMCD の二波励起条件の 実験配置でナノプローブを使った位置敏感測定を試みた^{2,30)}. 金属/酸化物界面の磁気トンネル接合のモデル試料 MgO 単 結晶(100)表面上に BCC 鉄を分子ビームエピタキシャル成 長させた多層膜断面を厚さ 50 nm で FIB サンプリングした. 測定には Tecnai F30 S/TEM 及び GIF Tridiem を用い、加速 電圧 300 kV、走査ステップ幅 0.8 nm、入射収束角 2.5 mrad で 200 励起二波条件の下、EELS 検出器の分散 0.2 eV/ch、収 集角 3.2 mrad にセットし、回折面上のカイラル ± 位置から 図 6 (a) の範囲において約 4,000 点から成る Fe-L_{2.3}SI デー タキューブを取得した.

統計処理の詳細は文献に譲るが、図6(b)に示すように、 主成分解析の最初の4成分から再構成したスペクトルと(23) 式によって、 m_L/\tilde{m}_s (この場合、界面歪みのため厳密には $\langle T_z \rangle$ 項を無視できないので、 $\tilde{m}_s = m_s + 7 \langle T_z \rangle$)値の空間分 布マップが得られる、Fe/MgO界面で m_L/\tilde{m}_s が有意に増大し



図 6 (a) Fe/MgO エピタキシャル 界面の断面 ADF-STEM 像. (b) ナノプローブ走査による EMCD 測定から求められた m_L/\tilde{m}_s 値の分布. (c) (b) の界面に平行な方向への投影平均 で得られた m_L/\tilde{m}_s 値の変化.

ていることがわかる. この m_L/\tilde{m}_s 値増大の起源を明らかに するために,第一原理理論計算によっていくつかの可能な界 面構造に対する m_L/\tilde{m}_s 値をシミュレーションした結果を図 7 に示す. これらの比較から,Fe/MgO 界面での m_L/\tilde{m}_s 値の増 大を生むためには,図 7 (a) のような相互拡散の無いシャー プな界面構造であることが予測される.

6.2 収束電子による原子面分解能 EMCD一究極の EMCD 測定へ

EMCD 測定の原理的アイデアは非弾性散乱電子間の位相 干渉によって選択則を操る点にある.そのために回折条件を 正確に定めたい(入射ビームの平行化)要請とノイズに対す る信号強度を稼ぎたい(入射ビームを絞りたい)要求が互い にトレードオフの関係にあり,当初から如何にして良いS/N 比のデータを得ることができるかが鍵となった.高い空間分 解能で信号強度を稼ぐためには,収差補正 STEM によるサ ブナノメートルサイズの収束電子の使用が望ましい.

そこで図8に示すような回折ディスクが重なり合うよう な収束電子による対称三波入射条件を考える³¹⁾. このとき収 差補正のためディスク内の電子位相はほぼ揃っているので, 固体内入射電子の波動関数 $\psi_i(\mathbf{r})$ のすべての寄与は, 図8に 黒丸で示したような特定の波数ベクトルを参照しながら,

$$\psi_{i}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}\in\Omega_{1}\cup\Omega_{2}} Ce^{i\phi_{\mathbf{k}}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \left[1 + iT_{G}e^{iG\cdot\mathbf{r}} + iT_{-G}e^{-iG\cdot\mathbf{r}}\right] + \sum_{\mathbf{k}\in\Omega_{2}} C\left\{e^{i\phi_{\mathbf{k}+G}}e^{i(\mathbf{k}+G)\cdot\mathbf{r}} \left[1 + iT_{G}e^{iG\cdot\mathbf{r}}\right] + e^{i\phi_{\mathbf{k}-G}}e^{i(\mathbf{k}-G)\cdot\mathbf{r}} \left[1 + iT_{-G}e^{-iG\cdot\mathbf{r}}\right]\right\}$$
(33)

と表すことができる³²⁾. ここで T_{G} は透過波ディスク強度に 対するブラッグ反射ディスクの相対強度で,図のような三波 対称励起条件では $T_{\pm G}$ は1より小さい.したがって反射波で ある $\pm G$ ディスクの外側 (Ω_{3} 領域)からの寄与は無視できる. これに対し非弾性散乱後の出射波 $\psi_{\ell}(\mathbf{r})$ を単純に平面波

 $\psi_f(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}_f \cdot \mathbf{r}} \tag{34}$

として(非弾性散乱後の弾性散乱を無視し、検出器は十分に



a) MgO sublayer

図7 Fe/MgO界面モデル構造における局在磁気角運動量の位置 依存性の理論計算結果.計算の詳細は文献30)を参照されたい.



図8 サブナノサイズ収束電子による EMCD 測定のための対称三波励起回折条件の模式図.

遠い位置に置いたとする), (17) 式を導いたときと同様に, (33), (34) 式を (2) 式に代入して式展開すると, $T_{\rm G}^2$ の項 を無視して結局,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial \Omega \partial E} &= C^2 \sum_{\mathbf{k} \in \Omega_1 \cup \Omega_2} \left\{ S(\mathbf{q}, \mathbf{q}, E) + 2T_{\mathbf{G}} \Im \left[S(\mathbf{q}, \mathbf{q} - \mathbf{G}, E) \right] \right\} \\ &+ \sum_{\mathbf{k} \in \Omega_2} C^2 \left\{ \left[1 + 2T_{\mathbf{G}} \sin(\varDelta \phi_{\mathbf{k}, \mathbf{G}}) S(\mathbf{q} - \mathbf{G}, \mathbf{q} - \mathbf{G}, E) \right] \\ &+ 2 \cos(\varDelta \phi_{\mathbf{k}, \mathbf{G}}) \operatorname{Re} \left[S(\mathbf{q}, \mathbf{q} - \mathbf{G}, E) \right] \\ &+ 2 \sin(\varDelta \phi_{\mathbf{k}, \mathbf{G}}) \Im \left[S(\mathbf{q}, \mathbf{q} - \mathbf{G}, E) \right] \right\} \end{aligned}$$
(35)

を得る³¹⁾. ただし $\Delta \phi_{\mathbf{k},\mathbf{G}} = \phi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} - \phi_{\mathbf{k}}$ である. (20) 式を得た ときと同様にして磁気信号成分(虚数部)だけを取り出すと

$$\frac{\partial^{2} \sigma}{\partial \Omega \partial E} \bigg|_{magnetic} = C^{2} \sum_{\mathbf{k} \in \Omega_{1} \cup \Omega_{2}} 2T_{\mathbf{G}} \Im [S(\mathbf{q}, \mathbf{q} - \mathbf{G}, E)] + \sum_{\mathbf{k} \in \Omega_{2}} 2C^{2} \sin(\varDelta \phi_{\mathbf{k}, \mathbf{G}}) \Im [S(\mathbf{q}, \mathbf{q} - \mathbf{G}, E)]$$
(36)

が得られる.右辺第一項は Classical EMCD の項であり,回 折面上で図5と同様の強度分布を持ち、プローブ位置に依 らない.注目すべきは右辺第二項で、収差補正のためディス クの内位相差 $\Delta\phi_{k,G}$ はゼロであるが、プローブ位置を原子面 直上から順次原子面に垂直方向(x 軸方向)に Δx だけずら すと、フーリエの定理³³⁾によって位相が $\phi_k = k_x \Delta x$ ずれるた め、 $\Delta\phi_{k,G} = G \Delta x$ となる.再び正味の磁化方向が光学軸(z 軸) に平行であると仮定すると、(36)式右辺第二項は双極子近 似の下で

$$\sum_{\mathbf{k}\in\Omega_2} 2C^2 \sin(G\Delta x) \frac{GM_z q_y}{q^2 (q^2 + G^2 - 2q_x G)}$$
(37)

の様に書き直すことができる. このプローブ位置に依存する 新たな磁気信号成分は, Classical EMCD による信号成分より 強い強度を持つ. (37) 式はプローブ位置によって正弦波的 な振る舞いをし,単純な立方晶結晶(面間隔*d*, $G = \frac{2\pi}{d}$,座 標原点を原子面上にとる)では, $\Delta x = 0$ (原子面直上)にプ ローブがあるときゼロ,また $G\Delta x = \pm \frac{\pi}{2}$,すなわち $\Delta x = \pm \frac{d}{4}$ のときに正負の最大値をとる.また回折面上G-O-G軸の両側 で磁気信号のカイラリティーの符号が異なることがわかる.

以上の運動学的考察の意義をもう少し具体的に見るため に、4.2節で述べた動力学散乱理論で、回折面上のEMCD 信 号分布のプローブ位置に対する変化をシミュレーションして みよう.加速電圧 200 kV,収束半角 10 mrad,プローブサイ ズ 0.1 nm の入射電子を厚さ 10 nm の BCC 鉄に $G = 110 \equiv$ 波対称励起条件 (Bragg 角 $2\theta = 12.4$ mrad)で入射させた (低 次晶帯軸からずらすため結晶方位を [114]入射にセット). 図 9 に入射電子プローブの原子面に対する相対位置に依存 して回折面上の磁気信号の分布変化を示す.運動学的議論と 定性的に一致するが、図 9 (b) に点線枠で示すような位置 に矩形の検出器絞りを配することで、比較的強い磁気信号を 取得できるのみならず、一回の走査で順次カイラル±信号 を得ることができるために、5節で述べた実験的問題点がほ ぼ解決される.

上記理論予測を実験的に検証した例を図 10 に示す. 試料 として約 10 nm 厚の BCC 鉄多結晶膜を用いた. 表面酸化を 防ぐために 5 nm 厚の非晶質 Si₃N₄ 膜上に鉄を蒸着後厚さ 3 nm のアルミキャップ層を蒸着した. JEM-ARM200F(加速 電圧 200 kV)を用い図 10 (a)のように 110 三波対称励起 条件の下,収束角 13 mrad のプローブを図 10 (b)の点線枠 内をステップ幅 0.02 nm で走査して GIF Quantum で Fe-L₂₃ スペクトルを取得した. 得られた SI データは,同時に取得



図9 厚さ10 nm の BCC 鉄 G = 110 対称三波励起条件下で 収束電子(収束角10 mrad) プローブを110 格子面(面間隔 d = 0.20 nm) に垂直方向に順次移動させたときの回折面上の Fe-L₃ ピーク位置での磁気信号強度分布の変化. 図中の丸印は 逆格子点位置を示す. プローブ位置は,ある110 面直上(a) から順次, d/8 間隔で移動.



図 10 (a) 110 三波対称励起条件での回折図形と検出器絞 り位置(赤破線枠).(b) ADF-STEM像.白枠の領域から SI データを取得した.(c) 抽出されたカイラル±スペクトルと EMCD 信号.(d) ADF-STEM像コントラストプロファイルと L₃ピーク位置での EMCD 信号強度分布.

した ADF 像コントラストを使ってドリフト補正を行い,主 成分解析でノイズ除去をした後に統計処理によって抽出した 成分スペクトルとその平均分布プロファイルを図 10 (c), (d) に示す³¹⁾. EMCD 信号から(24)式によって求めた m_1/m_s は 0.05 で, XMCD による 0.043 をほぼ再現する. また格子 面に対して確かに d/4 だけずれた位置にカイラル ± 信号ピー クが交互に現れている.

最新の理論的検討によると、この磁気信号は各格子面にき わめてよく局在しており、二重チャネリング効果による隣接 原子面からの寄与は、試料厚さに依存して数~10%にすぎ ない³⁴⁾. すなわち近い将来適当な結晶方位を選ぶことによっ て、磁気信号の相対符号(原子の持つ正味のスピン↑↓)を 含め磁性元素/サイト毎に測定できることが期待される.

7. むすび

S/TEM-EELS を使った EMCD の測定原理とその応用に関 する理論・実験的進展の経緯は、高エネルギー電子の回折理 論における歴史的発展のすべてを継承した延長上にある. 2006 年に最初に報告された EMCD 信号に比べ、その後の理 論・実験両面の地道な努力の積み重ねによって格段にデータ の質が改善し、ようやくこの手法の実材料への応用可能性が 見えてきた.

最後に日本の研究者によって見いだされ³⁵⁾,近年注目を浴 びている電子螺旋波(EVB)による EMCD 検出について触 れる必要があろう. 軌道角運動量を持つEVBを入射波に使っ て磁気信号を得るというアイデアは大変魅力的である. しか し高エネルギー電子において L・S 相互作用は、直接検出す るには非常に小さく、結局 EVB による EMCD 検出の原理的 な起源は本稿で考察したものと同じ位相干渉に帰着される. 理論的検討によると^{36,37)},EVB を磁性原子コラム直上におい た際に非常に強い磁気信号が得られることがわかっている が、未だに EVB による EMCD 検出は確認されていない(最 初に報告されたデータ³⁸⁾ は最近ようやく再検討され³⁹⁾、新 たな提案がなされた). 6.2 節の収束ビームの位相干渉のアイ デアは、実は収差補正 STEM のサブナノプローブに故意に 収差を導入して二色性信号を取得する巧妙な位相操作(走査 ではない)法から連想された^{32,40)}.これらの試みの今後のさ らなる進展を待ちたい.

謝 辞

本研究を遂行するにあたり, ウプサラ大学(スウェーデン), ユーリッヒ自然科学研究機構(ドイツ)の共同研究者たちと のたゆまない共同作業に感謝をしたい.また日本-スウェー デン二国間共同研究(JSPS-STINT),科学研究費補助金(基 盤研究 A,新学術領域研究,挑戦的萌芽研究)から財政的援 助を受けた.心からの謝意を表したい.

文 献

- 1) 武藤俊介,巽 一厳,Ján Rusz:日本結晶学会誌,56,387-392 (2014)
- 2) 武藤俊介:日本金属学会報 まてりあ, 56, 787-792 (2017)
- 3) 太田俊明(編): X線吸収分光法-XAFS とその応用, アイピーシー, 東京, 7-9 (2002)
- 4) 倉田博基, 小林隆史: 電子顕微鏡, 30, 53-59 (1995)
- Schattschneider, P.: Linear and Chiral Dichroism in the Electron Microscope, Pan Standard Publishing, Singapore, 181–190 (2012)
- 6) 寺澤寛一:自然科学者のための数学概論,岩波書店,東京, 403-443 (1954)
- 7) A.メシア(小出昭一郎,田村次郎 訳):メシア量子力学2,東京図書,東京,253-282 (1972)
- 8) Schattschneider, P. et al.: Nature, 441, 486-488 (2006)
- Schattschneider, P., Stöger-Pollach, M., Rubino, S., Sperl, M., Hurn, C., Zweck, J. and Rusz, J.: *Phys. Rev.* B, 78, 104413 (2008)

- Kohl, H. and Rose, H.: Adv. Electron. Electron Phys., 65, 173–226 (1985)
- Rusz, J., Eriksson, O., Novák, P. and Oppeneer, P.M.: *Phys. Rev.* B, 76, 060408(R) (2007)
- 12) Calmels, L., Houdellier, F., Warot-Fonrose, B., Gatel, C., Hÿtch, M.J., Serin V. and Snoeck, E.: *Phys. Rev.* B, **76**, 060409(R) (2007)
- 13) Muto, S., Tatsumi, K. and Rusz, J.: Ultramicrosc., 125, 89-96 (2013)
- 14) Yoshioka, H.: J. Phys. Soc. Jpn., 12, 618–628 (1957)
- 15) Schattschneider, P., Héber, C., Franco, H. and Jouffrey, B.: *Phys. Rev.* B, **72**, 045142 (2005)
- 16) Allen, L.J., D'Alfonso, A.J. and Findlay, S.D.: Ultramicrosc., 151, 11–22 (2015)
- 17) Rusz, J., Muto, S. and Tatsumi, S.: Ultramicrosc., 125, 81-88 (2013)
- 18) Rusz, J.: Ultramicrosc., 177, 20-25 (2017)
- Hebert, C. and Schattschneider, P.: Ultramicrosc., 96, 463–468 (2003)
- 20) Lidbaum, H., Rusz, J., Rubino, S., Leibig, A., Hjörvarsson, B., Oppeneer, P.M., Eriksson, O. and Leifer, K.: *Ultramicrosc.*, 110, 1380–1389 (2010)
- 21) 武藤俊介, 志賀元紀:表面科学, 37, 610-615 (2016)
- Spiegelberg, J., Rusz, J. and Pelckmanns, K.: Ultramicrosc., 175, 36–45 (2017)
- 23) Tatsumi, K., Muto, S., Rusz, J., Kudo, T. and Arai, S.: *Microscopy*, 63, 243–247 (2014)
- 24) Muto, S., Rusz, J., Tatsumi, K., Adam, R., Arai, S., Kocevski, V., Oppeneer, P.M., Bürgler, D.E. and Schneider, C.M.: *Nature Commun.*, 5, 3138 (2016)
- Wang, Z., Zhong, X., Yu, R., Cheng, Z. and Zhu, J.: *Nature Commun.*, 4, 1395 (2013)
- 26) Song, D., Rusz, J., Cai, J. and Zhu, J.: Ultramicrosc., 169, 44–54 (2016)
- 27) Schattschneider, P., Ennen, I., Löffler, S., Stöger-Pollach, M. and Verbeeck, J.: J. Appl. Phys., 107, 09D311 (2010)
- 28) Stöger-Pollach, M., Treiber, C.D., Resch, G.P., Keays, D.A. and Ennen, I.: *Micron*, 42, 456–460 (2011)
- 29) Salafranca, J., Gazquez, J., Pérez, N., Labarta, A., Pantelides, S.T., Pennycook, S.J., Batlle, X. and Varela, M.: *Nano Lett.*, **12**, 2499– 2503 (2012)
- 30) Thersleff, T., Muto, S., Werwinski, M., Spiegelberg, J., Kvashnin, Y., Hjörvarsson, B., Eriksson, O., Rusz, J. and Leifer, K.: Sci. Rep., 7, 44802 (2017)
- 31) Rusz, J., Muto, S., Spiegelberg, J., Adam, R., Tatsumi, K., Bürgler, D.E., Oppeneer, P.M. and Schneider, C.M.: *Nature Commun.*, 7, 12672 (2016)
- 32) Rusz, J., Idrobo, J.C. and Bhowmick, S.: Phys. Rev. Lett., 113, 145501 (2014).
- Cowley, J.H.: Diffraction Physics (3rd Edition), Elsevier, Amsterdam, 35–48 (1995)
- 34) Rusz, J., Spiegelberg, J., Muto, S., Thersleff, T., Ohtsuka, M., Leifer, K. and Oppeneer, P.M.: *Phys. Rev.* B, 95, 174412 (2017)
- 35) Uchida, M. and Tonomura, A.: *Nature*, **464**, 737–739 (2010)
- 36) Rusz, J. and Bhowmick, S.: Phys. Rev. Lett., 111, 105504 (2013)
- Schattschneider, P., Löffler, S., Stöger-Pollach, M. and Verbeeck, J.: Ultramicrosc., 136, 81–85 (2014)
- 38) Verbeeck, J., Tian, H. and Schattschneider, P.: Nature, 467, 301–304 (2010)
- 39) Schachinger, T., Löffer, S., Steiger-Thirsfeld, A., Stöger-Pollach, M., Schneider, S., Pohl, D., Rellinghaus, B. and Schattschneider, P: *Ultramicrosc.*, **179**, 15–23 (2017)
- 40) Idrobo, J.C., Rusz, J., Spiegelberg, J., McGuire, M.A., Symons, C.T., Vatsavai, R.R., Cantoni, C. and Lupini, A.R.: *Adv. Struct. Chem. Imag.*, 2, 5 (2016)